

FIB 技術先進システム研究会 第2回研究会プログラム

『保護膜の形成機構やダメージ層の物理ほか』

- 13:00—13:30 保護膜の形成機構 ～これまでの研究のレビューと検討～
日本電子(株) EP 事業ユニット 加藤 大樹
- 13:30—13:45 保護膜に関する自由討論 (会員からの関連質問対応含む)
- 13:45—14:15 電子線ホログラフィーを用いた半導体電位分布解析における
FIB ダメージ層
古河電気工業(株) 解析技術センター 佐々木 宏和
- 14:30—15:00 FIB-SIMS を用いた半導体デバイス解析における元素分析技術の進展
ローム(株) 品質本部 分析センター 阿久津 稔
- 15:00—15:30 FIB-SEM を用いたヒト皮膚組織の3次元微細構造解析
川崎医科大学 解剖学 山西 治代
- 15:45—16:15 TESCAN 社製プラズマ FIB-SEM
(株)東陽テクニカ (TESCAN) 鈴木 直久
- 16:15—16:45 TEM 試料作製法としての FIB 技術の歴史と現状課題
大阪大学 超高压電子顕微鏡センター 杉山 昌章
- 17:30～19:30 意見交換会 (有志)
場所：KABEAT -日本生産者食堂-
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番1号
KABUTO ONE 1F
兜町交差点横 (東西線茅場町駅 徒歩2分)
<https://kontext.jp/map/kabeat/>